

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成28年9月29日(2016.9.29)

【公開番号】特開2016-135784(P2016-135784A)

【公開日】平成28年7月28日(2016.7.28)

【年通号数】公開・登録公報2016-045

【出願番号】特願2016-12103(P2016-12103)

【国際特許分類】

C 07 H	21/00	(2006.01)
C 07 H	21/04	(2006.01)
B 01 J	20/22	(2006.01)
B 01 J	20/34	(2006.01)
B 01 J	20/30	(2006.01)
B 01 D	15/00	(2006.01)
G 01 N	1/34	(2006.01)
C 12 N	15/09	(2006.01)

【F I】

C 07 H	21/00	
C 07 H	21/04	A
B 01 J	20/22	C
B 01 J	20/34	G
B 01 J	20/30	
B 01 D	15/00	G
G 01 N	1/34	
C 12 N	15/00	A

【手続補正書】

【提出日】平成28年8月16日(2016.8.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

核酸結合相を用いて結合と溶出によって核酸を精製する方法であって、該核酸結合相が

：

(i) 核酸結合性のA基であって、アミノ基であり、かつ2-(ジメチルアミノ)エチルメタクリレート(DMAEMA)およびジエチルアミノプロピルトリメトキシシラン(DEAPS)から選択される化合物の一部分である、A基と、

(ii) 電荷中性のN基であって、ヒドロキシル基であり、かつアクリレートおよび反応性シランから選択される化合物の一部分であり、A基と相互作用しない、N基とを有すること；

該核酸結合相が修飾支持材であり、該修飾が：

(i) リガンドIが少なくとも1つのA基を有し、リガンドIIが少なくとも1つのN基を有する、少なくとも該リガンドIと該リガンドIIとを有する混合物での該支持材の修飾；

(ii) 該A基が、少なくとも1つのN基を有する化合物によって立体遮蔽される、該A基および該N基での該支持材の修飾；および

( i i i ) 該実施形態 ( i ) ~ ( i i ) の組合せによる該支持材の修飾からなる群より選択されること ; および

該方法が、少なくとも以下の工程 :

( a ) 4 ~ 7 . 5 の pH ( 結合 pH ) で、該核酸を該核酸結合相に結合させる工程と、

( b ) 該結合 pH よりも大きい pH ( 溶出 pH ) で、該核酸を溶出させる工程とを有すること

を特徴とする方法。

**【請求項 2】**

前記支持材が、A 基を有するシランでコートされたシリカ表面を有することを特徴とする、請求項 1 に記載の方法。

**【請求項 3】**

前記シランの量が、0 . 1 ~ 5 0  $\mu$  m o l である、請求項 2 に記載の方法。

**【請求項 4】**

前記シランの量が、0 . 1 ~ 1 0  $\mu$  m o l である、請求項 2 に記載の方法。

**【請求項 5】**

請求項 1 ~ 2 のいずれか 1 項による支持材を有することを特徴とする、核酸を精製するためのキット。